

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 4 月 12 日 (12.04.2001)

PCT

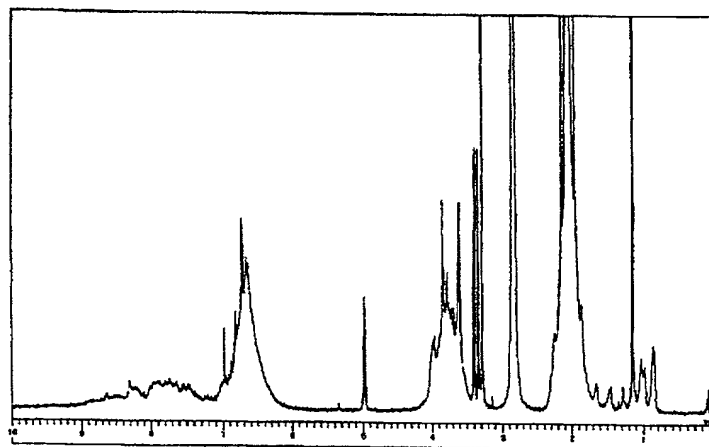
(10) 国際公開番号
WO 01/25853 A1

- (51) 国際特許分類: G03F 7/023, 特願2000/47391 2000 年 2 月 24 日 (24.02.2000) JP
C08L 33/06, H01L 21/027 特願2000/201837 2000 年 7 月 4 日 (04.07.2000) JP
特願2000/255215 2000 年 8 月 25 日 (25.08.2000) JP
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/06903
- (22) 国際出願日: 2000 年 10 月 4 日 (04.10.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願平 11/286418 1999 年 10 月 7 日 (07.10.1999) JP
特願平 11/333048 1999 年 11 月 24 日 (24.11.1999) JP
特願平 11/362994 1999 年 12 月 21 日 (21.12.1999) JP
特願平 11/367237 1999 年 12 月 24 日 (24.12.1999) JP
特願2000/45430 2000 年 2 月 23 日 (23.02.2000) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): クラリアントインターナショナルリミテッド (CLARIANT INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; CH-4132 ムッテンツ 1 ロートハウスシュトラッセ 61 Muttensz (CH).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋修一 (TAKAHASHI, Shuichi) [JP/JP]; 〒437-1496 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアント ジャパン株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 鐘尾宏紀, 外 (KANAOKI, Hiroki et al.); 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目10番14号 ばんだいビル むつみ国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

[続葉有]

(54) Title: PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 感光性組成物



ノボラック樹脂: アクリルポリマー = 100:10 (レジストフィルム)

NOVOLAK RESIN/ACRYLIC POLYMER = 100/10 (RESIST FILM)

(57) Abstract: A photosensitive composition comprising a resin composition and a photosensitive substance and useful as a photoresist, wherein the resin composition is either a mixture of two or more resins among which the difference in refractive index is at least 0.03 or a mixture of an alkali-soluble resin as a base resin with as a resinous additive a resin functioning as a dissolution inhibitor for the photosensitive composition, such as an acrylic polymer, methacrylic polymer, or styrene polymer. The photosensitive composition is preferably one having a rate of dissolution in 2.38 wt.% tetramethylammonium hydroxide solution of 5,000 Å/min or lower. Use of the resin composition is effective in reducing the amount of a quinonediazide photosensitizer to be used and in obtaining a photosensitive composition satisfying both of high sensitivity and high film thickness retention.

[続葉有]

25525853

WO 01/25853 A1